

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成21年10月15日 (2009.10.15)

【公表番号】特表2005-529485(P2005-529485A)

【公表日】平成17年9月29日 (2005.9.29)

【年通号数】公開・登録公報2005-038

【出願番号】特願2004-511407(P2004-511407)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/304 (2006.01)

B 2 4 B 37/00 (2006.01)

C 0 9 K 3/14 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/304 6 2 2 X

H 0 1 L 21/304 6 2 1 D

H 0 1 L 21/304 6 2 2 D

B 2 4 B 37/00 H

C 0 9 K 3/14 5 5 0 D

C 0 9 K 3/14 5 5 0 Z

【誤訳訂正書】

【提出日】平成21年8月28日 (2009.8.28)

【誤訳訂正 1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0 0 0 6

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0 0 0 6】

化学的機械的研磨組成物中の界面活性剤の使用は公知であるが、従来技術の文献のいずれも、アニオン、カチオンおよび両性界面活性剤など他の種類の界面活性剤に比較して非イオン界面活性剤の特定の利点を認識していない。非イオン界面活性剤が基板層除去速度の選択性の改善を提供することが見いだされた。本発明のこれらの利点および他の利点ならびに本発明の追加の特徴は、本明細書に提供する本発明の説明より明らかであろう。

【誤訳訂正 2】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0 0 0 9

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0 0 0 9】

本願に記載する化学的機械的研磨系は、研磨剤、研磨パッド、またはその両方を含む。前記 C M P 系が研磨剤と研磨パッドの両方を含むことが好ましい。研磨剤はどのような好適な形態でもよい（例えば研磨剤粒子）。研磨剤は研磨パッドに固定されていてもよく、および / または、微粒子形態にあり、かつ、液体キャリア中に懸濁していてもよい。研磨パッドはどのような好適な研磨パッドでもよい。研磨剤（液体キャリア中に存在し懸濁している場合）および両親媒性非イオン界面活性剤ならびに液体キャリア中に懸濁している他の全成分が、C M P 系の研磨組成物を形成する。